

Gebouw	Emissiebron (code afgasaanval)		Hoogte uitrook emissie (m boven maaiveld)	Activiteiten	Afgasbehandelings- techniek	Milieurelevante emissies	Controlevoorn	Onderhoud	Metingen								
									2014				2015				
	Systeem	Kanaal							(m-nv)	HF (mg/Nm ³)	F- (mg/Nm ³)	NH ₃ (mg/Nm ³)	CxHy (mg/Nm ³)	HF (mg/Nm ³)	F- (mg/Nm ³)	NH ₃ (mg/Nm ³)	CxHy (mg/Nm ³)
										Emissiegrenswaarde	3	3	30	75	3	3	30
FA	M3-AF01	AF01.1	45	Nat etsen, Chemical vapour depositie, Implantatie, Plasma etsen, Plasma resist strippen, Oven processen, Fotolithografie, Metalisatie, Cleaning wafers	Natte gasreiniging	Fluoride (F-) Ammoniak (NH ₃)	Meting 1 x per jaar + ERP's cat.B	ERP's in OH-programma	Gemiddelde	0,7	0,7	2,6	N.V.T.	0,4	0,4	0,8	N.V.T.
		95% betrouwbaarheidsinterval	0,4 - 0,7						0,4 - 0,7	1,6 - 3,6	N.V.T.	0,3 - 0,5	0,3 - 0,5	0,6 - 1,0	N.V.T.		
		Gemiddelde	0,8						0,8	2,3	N.V.T.	0,3	0,3	0,4	N.V.T.		
		95% betrouwbaarheidsinterval	0,5 - 1,1						0,5 - 1,0	1,4 - 3,2	N.V.T.	0,2 - 0,4	0,2 - 0,4	0,3 - 0,5	N.V.T.		
FA	M3-AF08 (NH ₃)		33	Nat etsen, Cleaning wafers	Natte gasreiniging	Ammoniak (NH ₃)	Meting 1 x per jaar + ERP's cat.B	ERP's in OH-programma	Gemiddelde	-	-	-	-	N.V.T.	N.V.T.	-	N.V.T.
									95% betrouwbaarheidsinterval	-	-	-	-	N.V.T.	N.V.T.	-	N.V.T.
FA	M3-AF09 (VOC)		45	Fotolithografie, Nat etsen, Cleaning wafers	-	VOC	Meting 1 x per jaar	OH-programma	Gemiddelde	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	43	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	74
									95% betrouwbaarheidsinterval	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	41 - 45	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	71 - 77
FA	M4-AF02	AF02.1	45	Nat etsen, Chemical vapour depositie, Plasma etsen, Plasma resist strippen, Oven processen, Fotolithografie, Metalisatie, Cleaning wafers	Natte gasreiniging	Fluoride (F-) Ammoniak (NH ₃)	Meting 1 x per jaar + ERP's cat.B	ERP's in OH-programma	Gemiddelde	1,9	1,8	-	N.V.T.	3,4	3,2	-	N.V.T.
		95% betrouwbaarheidsinterval	1,1 - 2,7						1,0 - 2,6	-	N.V.T.	2,6 - 4,0	2,6 - 3,8	-	N.V.T.		
		Gemiddelde	1,9						1,8	-	N.V.T.	2,9	2,8	-	N.V.T.		
		95% betrouwbaarheidsinterval	1,1 - 2,7						1,0 - 2,6	-	N.V.T.	2,3 - 3,5	2,2 - 3,4	-	N.V.T.		
FA	M4-AF03 (VOC)		45	Fotolithografie, Nat etsen, Cleaning wafers	Thermische naverbranding	VOC	Meting 1 x per jaar	OH-programma	Gemiddelde	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	32	-	-	-	3,2
									95% betrouwbaarheidsinterval	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	30 - 34	-	-	-	2,9 - 3,5
FA	M4-AF04 (NH ₃)		45	Nat etsen, Cleaning wafers	Natte gasreiniging	Ammoniak (NH ₃)	Meting 1 x per jaar + ERP's cat.B	ERP's in OH-programma	Gemiddelde	N.V.T.	N.V.T.	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	-	N.V.T.
									95% betrouwbaarheidsinterval	N.V.T.	N.V.T.	-	N.V.T.	N.V.T.	N.V.T.	-	N.V.T.
PD	M4-AF02	AF02-m1	26	Nat etsen, Cleaning wafers, Metalisatie, Chemical Mechanical Polishing, Cleaning wafers	Natte gasreiniging	Fluoride (F-) Ammoniak (NH ₃)	Meting 1 x per jaar + ERP's cat.B	ERP's in OH-programma	Gemiddelde	-	-	-	N.V.T.	-	-	-	N.V.T.
		95% betrouwbaarheidsinterval	-						-	-	N.V.T.	-	-	-	N.V.T.		
		AF02-m2	26						Gemiddelde	-	-	-	N.V.T.	-	-	-	N.V.T.
		95% betrouwbaarheidsinterval	-						-	-	N.V.T.	-	-	-	N.V.T.		
PD	M4-AF13		26	Implantatie	-	Fluoride (F-)	-	-	Gemiddelde	-	-	N.V.T.	N.V.T.	-	-	N.V.T.	N.V.T.
									95% betrouwbaarheidsinterval	-	-	N.V.T.	N.V.T.	-	-	N.V.T.	N.V.T.



D161304257